



دراسة الخواص الكهربائية لاغشية المركب $Cu(In_{1-x}Al_x)S_2$ الرقيقة المحضرة

بطريقة الرش الكيميائي الحراري

* بلال ياسين طاهر

جبير عبدالله نجم

مهدي حسن سهيل

جامعة بغداد - كلية العلوم
*جامعة الانبار- كلية العلوم

الخلاصة:

حضرت الاغشية الرقيقة للمركب $Cu(In_{1-x}Al_x)S_2$ بطريقة الرش الكيميائي الحراري كدالة الى التركيز [حيث $(x=0,0.1,0.2,\dots,1)$] ويسمك $(0.55\pm 0.05 \mu m)$ عند درجة حرارة القاعدة $300^\circ C$ ، ومن خلال دراسة حيود الاشعة السينية وجدنا بان الاغشية المحضرة تمتلك تركيب الجالكوبرايت ومتعددة التبلور ذو الترتيب الرباعي والاتجاه المفضل على طول المستوي (112)، سجل طيف الامتصاصية والنفاذية لمدى الاطوال الموجية (200-1100 nm) واستخدم لحساب معامل الامتصاص، وفجوة الطاقة البصرية، والانتقالات الالكترونية وجدت من النوع المباشر المسموح بقيمة فجوة الطاقة البصرية للمركب $CuInS_2$ هي 1.52 eV عند $x=0$ وللمركب $CuAlS_2$ تساوي 3.20 eV عند $x=1$ ، بينما قيم معامل الامتصاص كانت تساوي $(10^4-10^5 \text{ cm}^{-1})$ لجميع الاغشية المحضرة، ومن خلال معامل الامتصاص وحافة الامتصاص تم حساب قيمة التوصيلية الكهربائية التي تساوي 6.893 و $3.273 (\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$ والمقاومية للاغشية المحضرة تساوي 0.145 و $0.305 (\Omega \cdot \text{cm})$ لكل من $CuAlS_2$ و $CuInS_2$ على الترتيب.

معلومات البحث:

تاريخ التسليم: ٢٠٠٩/١٢/٠١
تاريخ القبول: ٢٠٠٩/١٢/٢٤
تاريخ النشر: ٢٠١٢ / ٠٦ / ١٤

DOI: 10.37652/juaps.2009.15590

الكلمات المفتاحية:

خواص كهربائية،
 $Cu(In_{1-x}Al_x)S_2$
اغشية الرقيقة،
الرش الكيميائي الحراري.

المقدمة

تم تحضير المركب $Cu(In_{1-x}Al_x)S_2$ باستخدام طرق مختلفة تتضمن طريقة انتقال البخار الكيميائي باستخدام اليود كاداة انتقال وطريقة تفاعل انتقال الغاز الكيميائي وطريقة التبخير متعدد المصادر للعناصر وكذلك طريقة التبخير المزوج للعناصر [4-6]. في هذا البحث نحاول حساب كل من التوصيلية والمقاومية الكهربائية لجميع الاغشية المحضرة من خلال معرفة الخواص البصرية للاغشية من حيث فجوة الطاقة البصرية ومعامل الامتصاص، ومدى تأثير الخواص البصرية على التوصيلية الكهربائية للاغشية المحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري، حيث تتجلى اهمية اشباه الموصلات الثلاثية ذات المدى الواسع من فجوة الطاقة مقارنة باشباه الموصلات الاخرى من حيث استخدامها في مختلف المجالات التطبيقية مثل نبائط القدرة العالية والحساسات عالية التردد وكطبقة امتصاص او نفوذ او طبقة وسطية في الخلايا الشمسية لامتلاكها خصائص ميكانيكية وبصرية وكهربائية وثباتية تركيبية جيدة [7].

صنعت البلورات المفردة للمحاليل الصلبة للمركب $Cu(In_{1-x}Al_x)S_2$ أول مرة من فيض المحاليل (Flux solution) حيث لا توجد معلومات في الادبيات عن هذه المواد، حيث ان المعلومات المقررة على طرق نماء البلورات المفردة التي تمتلك خصائص فيزيائية اقرت من خلال التطبيقات للمركبين $CuInS_2$ و $CuAlS_2$ حيث ان اشباه المركبات الثلاثية للمركبين متماثلة الكترونياً وتشابه مركبات AIBIV وتبلور بتركيب الجالكوبرايت، والمحاليل الصلبة للمركب $Cu(In_{1-x}Al_x)S_2$ تعتبر متقاربة الكترونياً لأنها تغطي المدى المرئي كلياً حيث فجوة الطاقة الممنوعة في $CuInS_2$ و $CuAlS_2$ هي 1.5 eV و 3.4 eV على التوالي [1]، التركيب البلوري للجالكوبرايت هو ذو شبكة مزدوجة (Super lattice) من تركيب كبريتيد الخارصين (Zincblende) ويتواجد ويتأثر شبكة c مضاعف تقريباً عما هو لرقائق الزنك [2]، ويتواجد كلا المركبين $CuInS_2$ و $CuAlS_2$ من نوع n-type و p-type [3].

* Corresponding author at: Baghdad University - College of Science, Baghdad, Iraq;
ORCID:
E-mail address:

الجزء العملي

تم استخدام منظومة الرش الكيميائي الحراري في تحضير الاغشية المعدة للدراسة وتتخلص هذه الطريقة برش محاليل المواد على قواعد الترسيب الزجاجية وتم استخدام شرائح زجاج الصودا المائي (المانى المنشأ) ماركة (Mariefeld) وبابعاد $(25*25*1)$ mm تقريباً ، واجريت عمليات التنظيف على هذه القواعد وجففت باستخدام هواء ساخن ومن ثم تغمر هذه القواعد في حاوية زجاجية مملوءة بحلول الايثانول لازالة اية شوائب عالقة وقد استخدمت هذه القواعد لكافة القياسات التركيبية والبصرية .

تم في هذا البحث اذابة املاح العناصر في ماء مقطر بعبارية معينة حيث حضر كل من محلول كلوريد النحاس (CuCl) بعبارية (0.02) مولاري وهو مصدر لايونات النحاس Cu+1 والمجهز من شركة (BDH) ومحلول كلوريد الانديوم (InCl3) بعبارية (0.08) مولاري وهو مصدر لايونات الانديوم (In+3) المنتج من قبل شركة (Seeilzl-Hannover(Riedal- (made in Germany) (dehaëAG) ومحلول كلوريد الالمنيوم (AlCl3) بعبارية (0.08) مولاري وهو مصدر لايونات الالمنيوم (Al+3) والمنتج من قبل شركة (Fluka) (Packed in Switzerland) وكذلك حضر محلول الثايوريا CS(NH2)2 بعبارية (0.16) مولاري وهو مصدر لايونات الكبريت (S-2) وجهاز من شركة (BDH) ايضاً .

بعد تحضير المحاليل تم اخذ حجوم من المحاليل حسب النسب الاتية Cu:In:Al:S 1:(1-x):(x):2 حيث ان قيمة X من (0-1) ، وبعد اخذ الحجوم المناسبة لكل رشة تم خلطها بخلط مغناطيسي وخفف المحلول بالماء المقطر الى 100ml حيث ان حجم المحلول 30ml ، وبعد ذلك وضعت قواعد الترسيب بعد عمليات التنظيف على سطح سخان الكهربائي (hote plate) لمدة عشرين دقيقة لكي تكتسب الحرارة اللازمة وسخنت الى درجة حرارة °C 300 وثبتت هذه الدرجة عن طريق المسيطر الحراري (thermocouple) وهي درجة الحرارة المناسبة لتبلور الاغشية ، حيث وجد ان درجة الحرارة الاعلى من °C 350 والاقل من °C 300 تؤدي الى تكوين اغشية غير متبلورة بصورة كاملة.

وتم وضع المحلول المراد رشه في المكان المخصص له وبعدها بدأت عملية الرش للمحلول وبفترات زمنية مدة كل منها عشر ثوان يعقبها فترة انقطاع لمدة ثلاثين ثانية وبمعدل رش 8.12 ml/min

وضغط جوي N/m^2 $1.01*10^5$ وثبتت جهازالرش على ارتفاع 30 ± 2 cm عن قواعد الترسيب وبعد الانتهاء من عملية الرش تترك القواعد الزجاجية على سطح سخان لمدة خمسة عشر دقيقة لكي يكتمل التبلور للاغشية.
وان الاغشية المحضرة كانت ذات لون بني ثم يتغير لونها الى برتقالي تدريجياً عند زيادة نسبة تركيز الالمنيوم في الاغشية وان كل الاغشية المضرة كانت تمتلك سمك 0.55 ± 0.05 µm تقريباً.

النتائج والمناقشة

تم اجراء الفحص التركيبي (XRD) على الاغشية المحضرة ويبين الشكل (1) العلاقة بين الشدة والزاوية 2θ طبقاً لبطاقة (ASTM) ويثبت النتائج ان جميع الاغشية المحضرة هي متعددة التبلور (polycrystalline) والاتجاه المفضل هو (112) وتظهر طور مفرد (single phase) والوجه البلورية الاخرى الملاحظة هي (200,220,312) وان وجودها يعني تكون تركيب الجالكوبرايت (chalcopyrite) ذو الترتيب الرباعي (tetragonal arrangement) [8,9].

[10] حسب معامل الامتصاص باستخدام المعادلة

$$\alpha = 2.303 \frac{(A - A^l)}{d} \dots (1)$$

حيث α معامل الامتصاص، A الامتصاصية، A^l عامل التصحيح، d سمك الغشاء.

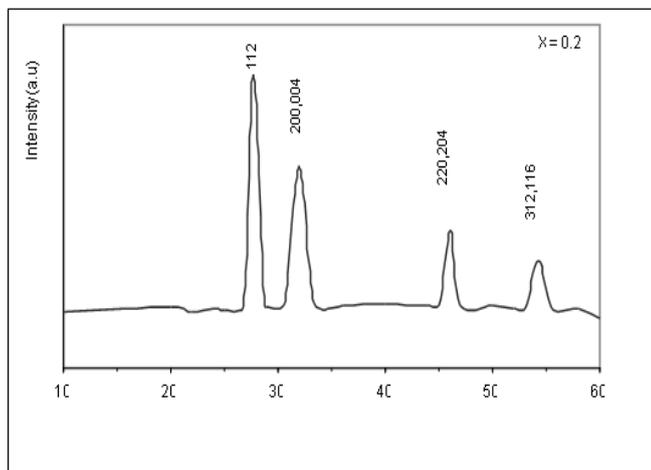
ويثبت النتائج ان جميع الاغشية المحضرة تمتلك فجوة طاقة [10] بصرية مباشرة وحسبت من خلال العلاقة

$$\dots (2) \quad ah\nu = A(h\nu - E_g)^{1/2}$$

حيث A ثابت، h ثابت بلانك، ν تردد الفوتون الساقط، E_g فجوة الطاقة المباشرة للانتقال المباشر المسموح وحددت بواسطة الرسم البياني بين $(ah\nu)^2$ ضد طاقة الفوتون (hv) وحسبت من خلال تقاطع مماس المنحني الناتج مع محور طاقة الفوتون حيث نقطة التقاطع تمثل فجوة الطاقة البصرية، ويبين الجدول رقم (1) قيم فجوة الطاقة المحسوبة لكل من تركيز الالمنيوم للمركب الناتج وتساوي 1.52 eV و 3.20 eV للمركب $CuAlS_2$ و $CuInS_2$ على الترتيب.

وايون الالمنيوم Al^{+3} مع ايون الكبريت S-2 وحيث ان الالمنيوم يمتلك كهروسالبية (Electronegativity) (مقياس التجاذب النسبي) اقل مما للاندسيوم فان الفرق في الكهروسالبية بين ايون الالمنيوم والكبريت هو اكبر مما هو لايون النحاس مع الكبريت وهذا يعني الزيادة في قدرة الجذب الالكتروني لذلك الايون ، حيث الكهروسالبية لهذه الايونات هي [15] (Al=1.5,In=1.7,S=2.5) .

اما الشكل (3) فيمثل العلاقة بين المقاومة الكهربائية للاغشية المحضرة وتركيز الالمنيوم في الاغشية (x) حيث تراوحت قيمها بين 0.145 للمركب $CuInS_2$ عند $x=0$ و $1-(ohm.cm)$ و 0.305 للمركب $CuAlS_2$ عند $x=1$ حيث نلاحظ زيادة المقاومة عند زيادة تركيز الالمنيوم في الاغشية وهذا يعكس بالطبع حقيقة ان التوصيلية تتناسب عكسياً مع المقاومة حيث يمكن تفسير نقصان التوصيلية وزيادة المقاومة عند زيادة تركيز الالمنيوم في الاغشية المحضرة على اساس التركيب البلوري للمركب حيث يزداد التقصص البلوري عند زيادة تركيز الالمنيوم في الاغشية نتيجة قصر مسافة الاواصر بين ذرتي Al-S مقارنتاً بأصرة In-S وبالتالي زيادة قوة هذه الاصرة في المركب والتي تحتاج الى قوة اكبر لكسرها عند تحرير الالكترونات وهذا يعني زيادة فجوة الطاقة كما هو واضح في الجدول (2) ويمكن تفسيرها ايضاً على اساس ثابت العزل (الاستقطابية) حيث عند زيادة تركيز الالمنيوم في الاغشية فان ثابت العزل يزداد وهذا يعني زيادة الاستقطابية الالكترونية اي الاتجاه نحو الترددات البصرية العالية اي تكون هناك كثافة ثنائي قطب كبيرة والتي تؤدي الى ظهور حاجز جهد كبير يعرقل مرور الاشعة خلال الاغشية اي زيادة الامتصاصية في الاغشية.



شكل (1) يمثل اطيفاء الحيود للأشعة السينية للمركب $Cu(In_{1-x}Al_x)_2S_2$ بتركيز (x=0.2).

جدول (1) يمثل قيم فجوة الطاقة المحسوبة لكل المركبات للتركيز (x=0 to

x=1).

x	compound	E_g (ev)
0	$CuInS_2$	1.52
0.1	$Cu(In_{0.9}Al_{0.1})S_2$	1.70
0.2	$Cu(In_{0.8}Al_{0.2})S_2$	1.80
0.3	$Cu(In_{0.7}Al_{0.3})S_2$	2.15
0.4	$Cu(In_{0.6}Al_{0.4})S_2$	2.42
0.5	$Cu(In_{0.5}Al_{0.5})S_2$	2.50
0.6	$Cu(In_{0.4}Al_{0.6})S_2$	2.70
0.7	$Cu(In_{0.3}Al_{0.7})S_2$	2.80
0.8	$Cu(In_{0.2}Al_{0.8})S_2$	2.90
0.9	$Cu(In_{0.1}Al_{0.9})S_2$	3.00
1	$CuAlS_2$	3.20

أما الخواص الكهربائية من حيث التوصيلية الكهربائية σ (ohm.cm)⁻¹ والمقاومية ρ (ohm.cm) لجميع الاغشية المحضرة تم حسابها من خلال الخواص البصرية وذلك بمعرفة كل من حافة الامتصاص λ^0 ومعامل الامتصاص α ، حيث التوصيلية الكهربائية تساوي [12]

$$\sigma = \frac{\lambda^0(\alpha)^2}{\pi \mu \cdot c} \quad \dots(3)$$

والمقاومية من خلال المعادلة التالية

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad \dots(4)$$

حيث ان:

μ^0 - النفاذية المغناطيسية في الفراغ.

ويمثل الشكل (2) العلاقة بين التوصيلية الكهربائية (σ) للاغشية المحضرة وتركيز الالمنيوم في الاغشية (x) ، حيث تراوحت قيمة التوصيلية الكهربائية للمركب $CuInS_2$ 6.893 عند التركيز $x=0$ و $1-(ohm.cm)$ للمركب $CuAlS_2$ عند تركيز $x=1$ ، وقد تمت مقارنة النتائج مع باحثين آخرين كما في الجدول التالي:

جدول (2) يمثل مقارنة النتائج الحالية مع نتائج باحثين آخرين.

Compound	σ (ohm.cm) ⁻¹	المصدر
$CuAlS_2$	5.866	13
$CuAlS_2$	$3.85 \cdot 10^{13}$ to $6.80 \cdot 10^{13}$	14
$CuAlS_2$	3.273	الدراسة الحالية
$CuInS_2$	6.893	الدراسة الحالية

حيث نلاحظ تناقص التوصيلية الكهربائية عند زيادة نسبة الالمنيوم في الاغشية وهذا يدل على تقصص التركيب البلوري اي حدوث تركيب الجالكوبرائيت نتيجة زيادة الالمنيوم في الاغشية وحدث سحب غير متكافئ للايونات الموجبان في المركب وهما ايون النحاس Cu+I

- 4-X.C.Shen, P. Dwight and K. Woid, (1988). "Materials Research Bulletin", vol.23, no.6, p.799-803.
- 5- M.W.Haimbodi , E.Gourmelon , P.D.Paulson , R.W.Birkmire and W.N.Shafarman , (2000) ." proc.28th IEEE photovoltaic (pvsc) specialists conference " , Anchorage , Alska , p.454 .
- 6- W.N. Shafarman, M.W.Haimbodi and R.W. Birkmire, (2002). "Institute of Energy conversion", university of Delaware, New york , DE19716-3820 , USA .
- 7-Patric G. Soukiassian, (2007). "J. phys: Appl. phys", L40.
- 8-Schmerber, M. Kanzari and .Rezig , (2009). "Thin Solis Films", no.7, vol.517, p.2191-2194.
- 9-K.T.Ramakrishna Reddy and R.B.V. Chalapathy, (1999). "Cryst. Res. Technol. ", vol.34, no.1, p.127-132.
- 10- J. A.najim, (2004). "Journal of Science and Engineering", vol.5, p.1.
- 11-K.S. Ramaiah, V.S. Raja, F.S. Juang, (2000). "Semicond. Sci. Technol", vol.15, p.6761.

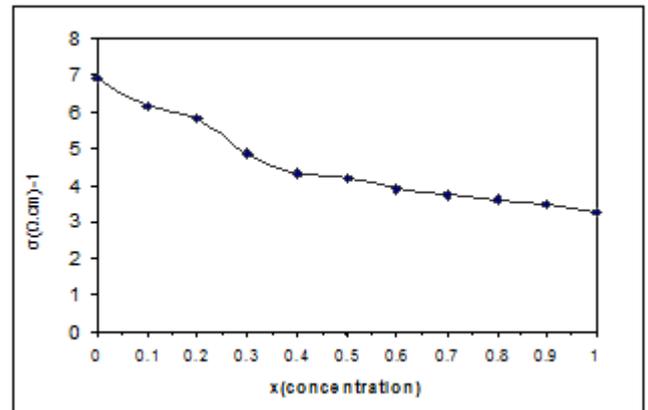
12-"البصريات الفيزيائية"، د. حسن الشريتي ، د. بتول حميد فرج الخياط، د. صبحي كمال حسون ، ١٩٨٣، جامعة بغداد، كلية التربية.

المالكي سمية حسن، ١٩٩٢. " دراسة الخواص البصرية والكهربائية لاغشية المركب CuAlS₂ واغشية

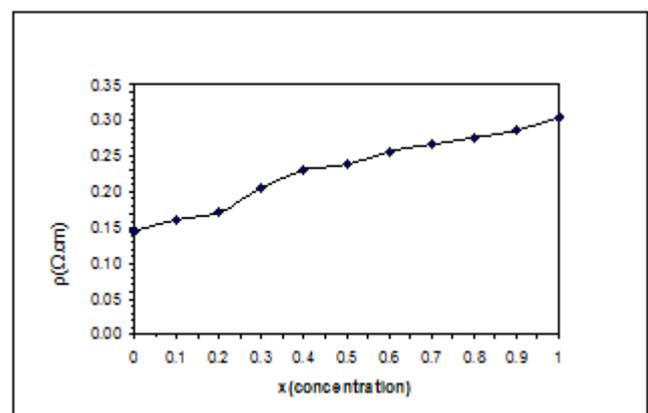
13- المركب CuAlS₂:Mn المحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري"، رسالة ماجستير ، كلية العلوم ، جامعة البصرة.

14. N. okoli, M.Sc, A.j. Ekpunobi, ph.D, and C.E. Okeke, ph.D, (2006)."The Pacific Journal of science and Technology", vol.7, no.1

15- H. Stephen Stoker, (1983). "Introduction to Chemical Principles".



شكل (2) يمثل العلاقة بين التوصيلية الكهربائية وتركيز الألمنيوم في الاغشية المحضرة.



شكل (3) يمثل العلاقة بين المقاومة الكهربائية وتركيز الألمنيوم في الاغشية المحضرة.

المصادر

- 1- L.A. Aksenov, S.A. Crutso, L.A. Makovetskaya, G.P. popelinyuk and V.A. Rubtsov, (1988) "Inorg. Matter. (USA)", vol.24 , no.4 , p.465-467 .
- 2-T.LÖher, A. Klein, (1997)."J.Apple. Phys.", vol.81, no.12, p.7806.
- 3- Aksenov, I.A. Gulakov, I.R. Lipnitskii, V.I. Lukomskii and A.I. Makovetskaya,(1989). "physica status solidi(A) Applied Research " vol.115 , no.1 , p.k113-k116 .

STUDING OF ELECTRIC PROPERTIES OF THIN FILMS FOR THE COMPOUND CU (IN1-XALX) S2 PREPARED BY CHEMICAL SPRAY PYROLYSIS

MAHDI H.SHEAL

JNBAIER A. NAJEM

BELAL Y.TAHER

ABSTRACT:

Thin films of $\text{Cu}(\text{In}_{1-x}\text{Al}_x)\text{S}_2$ have been prepared using chemical spray pyrolysis method as a function of the concentration [where $(x=0,0.1,0.2,\dots,1)$] with thickness $(0.55\pm 0.05 \mu\text{m})$ at substrate temperature of 300°C , through the study of X-ray diffraction we found the prepared thin films have polycrystalline and chalcopyrite structure with tetragonal arrangement, and preferred orientation along (112) direction, The absorptance spectra have been recorded for wavelength range (200_1100 nm) were used to calculate the absorption coefficient and optical energy gap, and the electronic transition were found of the allowed direct type and value of energy gap for CuInS_2 equal 1.52 eV at $x=0$ and equal 3.20 eV for CuAlS_2 at $x=1$, whereas the absorption coefficient values be $(10^4\text{-}10^5 \text{cm}^{-1})$ in all prepared thin films, through the absorption coefficient and absorption edge we calculated the value of the electrical conductivity that equal 6.893 and 3.273 $(\Omega\cdot\text{cm})^{-1}$ and value of resistivity for prepared films that equal 0.145 and 0.305 $(\Omega\cdot\text{cm})$ for CuInS_2 and CuAlS_2 respectively.